

⑯ BUNDESREPUBLIK

DEUTSCHLAND



DEUTSCHES

PATENT- UND
MARKENAMT

Offenlegungsschrift

⑯ DE 100 63 239 A 1

⑯ Int. Cl. 7:

G 03 F 7/20

G 02 B 13/14

G 02 B 13/18

⑯

⑯ Aktenzeichen: 100 63 239,4
⑯ Anmeldetag: 19. 12. 2000
⑯ Offenlegungstag: 28. 6. 2001

⑯ Unionspriorität:
11-362257 21. 12. 1999 JP

⑯ Anmelder:
Nikon Corp., Tokio/Tokyo, JP

⑯ Vertreter:
Grünecker, Kinkeldey, Stockmair & Schwahnhäuser,
80538 München

⑯ Erfinder:
Kumagai, Satoru, Chigasaki, Kanagawa, JP

Die folgenden Angaben sind den vom Anmelder eingereichten Unterlagen entnommen

⑯ Projektionsbelichtungseinrichtung und Verfahren zur Herstellung von Geräten unter deren Verwendung

⑯ Um eine Projektionsbelichtungseinrichtung zur Verfü-
gung zu stellen, die eine hohe optische Qualität bei der
Herstellung von Geräten bei einer Lichtquelle erzielen
kann, die Vakuumultraviolettlicht verwendet, ist ein opti-
sches Beugungselement, das auf einem Substrat vorge-
sehen ist, das aus Quarzglas mit einer kleinen Menge an
einer anderen Substanz besteht (beispielsweise Fluor, Hy-
droxylradikal, Wasserstoff, und/oder Kombinationen hier-
aus) in dem optischen Projektionssystem und/oder dem
optischen Beleuchtungssystem der Belichtungseinrich-
tung vorgesehen.

DE 100 63 239 A 1

DE 100 63 239 A 1